

離子束研磨系統



一、簡介：

此設備用於為穿透式電子顯微鏡試片製作。穿透式電子顯微鏡的試片厚度需低於數十奈米，以得到良好的分析影像。這樣的厚度非傳統機械式研磨可以輕易達到，而利用此套系統，以氬氣離子將試片轟擊以產生電子可穿透的薄區，提供可靠的試片製作方法。離子轟擊的過程中，試片表面很容易產生非晶相的薄膜，影響穿透式電子顯微鏡中高解析影像的品質。這套設備可以利用低加速電壓產生較低能量的氬氣離子，將試片表面的非晶層清除。

二、型號：Gatan Precision Ion Polishing System II, 695.B。

三、規格：

1. 電壓輸出範圍: 100V~8kV。
2. 離子束入射角度 ± 10 度。

四、試片尺寸：

1. 標準 TEM 試片尺寸(直徑為 3 mm 圓盤)。
2. 試片須先以機械研磨方式剪薄至 20 μm 。

五、放置位置：工學院綜合大樓 B24 室。

六、負責技術人員：謝坤州先生。